

LayTec、丸文、STR Japan、PANalytical 共催 エピタキシャル成長中の“歪み・基板の反り”セミナー @名古屋・横浜(参加費無料)

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。この度、LayTec AG、STR Japan 株式会社及び PANalytical の共催により、“歪みおよび基板の反り”セミナーを開催しますので、ご案内申し上げます。

光学および電子デバイスにおいて、高品質結晶成長および高効率デバイスを実現する為には、エピタキシャル成長に生じる歪みおよび基板の反りを制御することは重要な課題です。この課題に対して、LayTec は in-situ(その場観察)、STR はシミュレーション、PANalytical は X 線回折と、三社が異なる先端ソリューションを提供しています。

本セミナーでは、“歪みおよび基板の反り”を共通のテーマとして、三社が有する異なる技術を多角的に用いて、分析、シミュレーション技術の基礎的内容から最新の応用事例までを広く紹介いたします。エピタキシャル材料の歪み及び反りについて、包括的に理解することができる最適な機会です。

東京大学の杉山正和先生より実際の結晶成長における事例を紹介頂く招待講演も予定しています。

終了後に、広い分野の研究者の方々と交流できるよう、参加費無料のささやかな懇親会も計画しております。

光学および電子デバイスのエピタキシャル成長に従事されている、企業／研究機関／大学(学生様歓迎します)ご所属の皆様、お誘い合わせの上、お気軽にお申し込み下さい。

時間	プログラム (名古屋・横浜会場とも同一プログラム)
13:30	受付開始
13:45-13:55	開催挨拶 LayTec AG 富田 勇人
13:55-14:40 (45 分間)	その場観察によるさまざまな応用例の紹介 成長中に反りなどのその場観察する事により、今まで分からなかった事がいろいろ見えてきます。今回は様々な素子(LED、パワーデバイス、GaAs/InP 系素子等)に応用した事例を併せて紹介いたします。 LayTec AG 富田 勇人
14:40-15:10 (30 分間)	III 族窒化物エピ成長における歪・転位シミュレーションソフトウェア MOCVD 法による異種基板上的の III 族窒化物の成長中・冷却中におけるヘテロ構造内の応力、反り、転位の伝播・発生の変化を計算するシミュレーションソフトウェア STREEM AlGaIn edition の機能、及び解析事例を紹介いたします。 STR Japan 株式会社 向山 裕次
15:10-15:40	休憩時間
15:40-16:25 (45 分間)	XRD でわかるエピタキシャル薄膜の歪み・反りの測定原理と応用例 ロックンブ測定での曲率半径(反り)の算出方法や最新の半導体検出器を利用して数分で測定可能となった逆格子マップ測定による表面平行・垂直方向歪みの算出方法について測定原理と応用例を紹介いたします。 PANalytical 草野 修治
16:25-16:55 (30 分間)	LED の活性層領域における歪・転位の数値解析 MOCVD 法による III 族窒化物の成長レシピが LED の活性層領域のヘテロ構造特性(インジウム組成分布、転位密度分布)へ与える影響、またそれらの特性とデバイス特性の相関関係に関してシミュレーションソフトウェア STREEM InGaIn edition、SiLENSe の機能、解析事例を交えて紹介いたします。 STR Japan 株式会社 飯塚 将也
16:55-17:45 (50 分間)	(招待講演) III-V 化合物半導体の MOVPE における格子歪みの解析とデバイス応用 デバイス特性に大きく影響する結晶層の歪みについて、in situ モニタ、XRD、シミュレーションによる解析を、GaIn on Si 構造、太陽電池用 GaAs 系歪み補償量子井戸を例に紹介する。 東京大学 工学系研究科電気系工学専攻 杉山正和 先生
18:00-19:30	懇親会(軽食)

記

日時:2016年10月18日火曜日

会場:

- ~~セミナー:名古屋国際センター3F 第2研修室~~

~~(地下鉄桜通線国際センター駅直結もしくは名古屋駅から東へ徒歩7分)~~

~~<http://www.nie-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/aramashi/nieaccess>~~

~~定員40名~~

- ~~懇親会:同上~~

定員に達しましたので、お申し込みを締め切ります。

日時:2016年10月19日水曜日

会場:

- セミナー:横浜ビジネスパーク ウェストタワー7F 大会議室

(相鉄線天王町駅南口より徒歩5分もしくはJR保土ヶ谷駅から無料シャトルバス)

<http://www.officenomura.jp/ybp/access/>

定員50名

- 懇親会:横浜ビジネスパーク ウェストタワー1F Espresso Americano 横浜ビジネスパーク店

- 参加費:無料(懇親会参加費を含む)

- 申込方法:参加ご希望の方は、以下必要事項を明記のうえ、弊社営業部までお申し込みください。

➤ 必要事項

◇ 所属団体

◇ 部署

◇ お名前(フリガナも)

◇ 電話番号

◇ メールアドレス

◇ 住所

◇ 参加ご希望の会場(横浜)

◇ 懇親会への出席(○か×)

- 宛先:STR Japan 株式会社 営業部:str-sales@str-soft.co.jp

(上記メールリングリスト宛のメッセージは、担当者全員に送信されます)

- 補足

➤ お申込み期限:2016年10月11日(火曜日)17:00

➤ 定員になり次第、受付を終了いたします。

➤ 本セミナーへお申込みいただきましたお客様情報は、各社のお客様の個人情報の取り扱いに沿って十分留意したうえで、STR Japan, LayTec, 丸文、PANalytical で共有いたします。

以上